

株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ

枚葉式洗浄装置「SU-3300」を発売

～世界最高水準の生産性と高い処理性能を実現～

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズはこのほど、世界最高水準^{※1}となる処理能力と、独自の洗浄処理技術を備えた半導体ウエハーの枚葉式洗浄装置^{※2}「SU-3300」を開発。2016年9月から販売を開始します。

**SU-3300**

☆この画像の印刷用データ（解像度300dpi）は、
下記URLよりダウンロードできます。

www.screen.co.jp/press/download/SPE160901.zip

近年、半導体デバイスの微細化・多様化に伴い、ウエット洗浄装置には微細なパターンの倒壊抑制、微小パーティクルの制御などの課題をクリアする安定性と、さらなるトータルコスト低減を実現する高い経済性が求められています。

このような業界の要求に応えるため当社は、長年培ってきた枚葉式洗浄装置のノウハウを継承し、さらに進化させた7機種目となる新製品「SU-3300」を開発しました。この装置は、チャンパーサイズを最小化した4段積みタワー構造により最大24台のチャンパーの搭載が可能。設置スペースの効率化と併せて世界最高水準の生産性を実現しました。また、洗浄処理においても、定評のある独自のクリーン化技術を進化させた「APAC2」^{※3}を搭載。チャンパー内の処理環境を向上させ、微細化が進む半導体デバイスに対応します。さらにエッチングの均一性と薬液消費量の削減を同時に実現する「Nano control nozzle」^{※4}や、微細なパターンの倒壊を抑制する乾燥技術「Nanodry7」^{※5}など、処理性能を高める独自の新技術を搭載しています。

当社は、今回「SU-3300」を枚葉式洗浄装置のラインアップに加えることにより、お客さまの幅広いニーズに対応し、半導体デバイス業界へのさらなる発展に貢献していきます。

※1 実用洗浄処理の領域における生産性（2016年8月現在、当社調べ）。

※2 ウエハーを1枚ずつ洗浄する装置。50枚のウエハーを一度に洗浄するバッチ式洗浄装置よりも洗浄能力が高い。近年、スループットにおいてもバッチ式洗浄装置と同等のレベルが求められている。

※3 「Advanced Process Atmosphere Control 2」の略。チャンパー内の超清浄化を実現する当社独自のクリーン化技術。当社枚葉式洗浄装置「SU-3200」で定評のある技術をさらに進化させてチャンパー内の処理環境が向上している。

※4 薬液の温度・流量・吐出位置を高精度に制御する当社独自技術により、従来ノズルの約半分の薬液使用量で、均一性の高いエッチングが行える。

※5 ウエハー上の気液界面（三相界線）の制御を、高精度かつスピーディーに処理する新乾燥技術。チャンパー内の温度・湿度を常に最適な状態にコントロールすることにより微細なパターンの倒壊抑制に優れた効果を発揮。

* この装置は、2016年9月7日（水）から9日（金）まで台湾で開催される「SEMICON Taiwan 2016」にてご紹介します。

● 本件についてのお問い合わせ先

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 経営戦略統轄部 Tel: 075-417-2527 speinfo@screen.co.jp